

ICS 77.150.99
H 63

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1025—2015

电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材

High-purity tungsten and tungsten alloy sputtering target used
in electronic film

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国有色金属
行 业 标 准
电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材
YS/T 1025—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2016年1月第一版

*

书号: 155066·2-29184

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位:宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、北京天龙钨钼科技股份有限公司、株洲凯特实业有限公司、西安方科新材料科技有限公司。

本标准主要起草人:姚力军、王学泽、丁照崇、张涛、扶元初、袁海军、郑文翔、宋佳、苏国平、钱红兵、袁洁、王兴权、张玉利、王越、杜铁路。

电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材

1 范围

本标准规定了电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单(或合同)等内容。

本标准适用于电子薄膜用高纯钨及钨合金溅射靶材,以下简称高纯钨及钨合金靶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4324.23 钨化学分析方法 第23部分:硫量的测定 燃烧电导法和高频燃烧红外吸收法

GB/T 4324.25 钨化学分析方法 第25部分:氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法

GB/T 4324.26 钨化学分析方法 第26部分:氮量的测定 脉冲加热惰气熔融-热导法和奈氏试剂分光光度法

GB/T 4324.27 钨化学分析方法 第27部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法

GB/T 8651 金属板材超声波板探伤方法

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 900 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 901 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 产品按外形分为圆形、矩形和异形(如三角形等)。

3.1.2 靶材的背板为铜及铜合金或铝及铝合金。

3.1.3 根据合金材料不同,分为纯钨靶、钨钛合金靶、钨硅合金靶三种靶材。

3.1.4 产品按化学成分分为 W-99.999、WTi-99.9、WTi-99.95、WTi-99.99、WTi-99.995、WTi-99.999、WSi-99.99、WSi-99.999 八个牌号。

表示方法和标记示例如下:



示例: 纯度为 99.999% 的高纯钨靶, 表示为 W-99.999。